



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA



POLO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO  
DI NAVACCHIO

## 1995-2005: DIECI ANNI DI STANDARDIZZAZIONE XRD

VENERDÌ 01 LUGLIO 2005

POLO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO  
AUDITORIUM INCUBATORE  
NAVACCHIO DI CASCINA (PI)

### PROGRAMMA

14.30	Apertura dei lavori e saluti da parte delle Autorità del Polo Scientifico e Tecnologico di Navacchio (Presidente <b>Alessandro Giari</b> ) e dell'Università di Pisa (Pro-Rettore per i rapporti con imprese e per il trasferimento tecnologico <b>Giancarlo Santoprete</b> )
15.00 – 15.30	<b>Elio Tolle</b> – Presidente Commissione UNI/PND “ <b>Ruolo delle Normazione nel quadro delle legislazioni e politiche italiane ed europea</b> ”
15.30 – 16.0	<b>Giovanni Berti</b> – Convenor CEN/TC138 WG10 “ <b>Avvio del processo Europeo di prioritizzazione della XRD</b> ”
16.00 – 16.20	<b>Francesco De Marco</b> – Segretario CEN/TC138 WG10 – “ <b>Estratto del documento CEN/TC138 N.652 New Business of NDT X-Ray Diffraction</b> ”
16.20 - 16.40	Coffee-Break
16.40 – 17.40	“ <b>Discussione e nuove proposte da parte degli esperti italiani</b> ”
17.40 - 18.00	Considerazioni Conclusive

SABATO 02 LUGLIO 2005

AULA MAGNA STORICA  
UNIVERSITÀ DI PISA

### PROGRAMMA

Presiedono: <b>Paola Spadon</b> - Presidente Associazione Italiana Cristallografia <b>Elio Tolle</b> – Presidente Commissione UNI/PND	
09.30 – 10.30	<b>Giovanni Berti</b> – Convenor CEN/TC138 WG10 – Ricercatore Università di Pisa “ <b>Memoria di A.J.C. Wilson un pioniere della moderna diffrattometria RX da polveri</b> ”
10.30 – 11.00	Coffee-Break
11.00 – 11.30	<b>Carlo De Petris</b> – Vice Presidente Commissione Prove Non Distruttive UNI – Responsabile laboratorio CND - ISPESL “ <b>I metodi non distruttivi nel quadro delle direttive italiane ed europee</b> ”
11.30 – 12.00	<b>Giuseppe Augugliaro</b> – Coordinatore Italiano GL30/UNI – Laboratorio CND - ISPESL “ <b>Lo standard Tecnico della Diffrazione a Raggi x per controlli non distruttivi</b> ”
12.00 - 12.30	<b>Discussione</b>
12.30	Considerazioni Conclusive